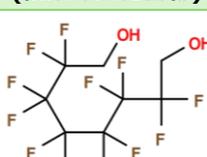
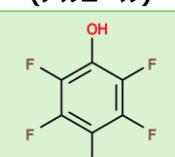
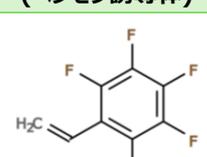
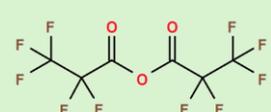
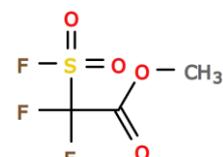
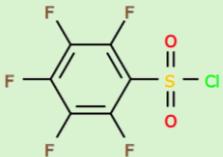
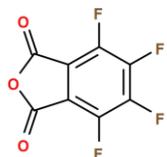


[用途別分類]

2-2. 機能性高分子関連原料、リソグラフィー関連原料

番号	化学式 (*分類)	名称	CAS No.	備考
1	 (複素環式化合物)	Perfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxole)	37697-64-6	高耐熱透明フッ素樹脂、高い DUV 透過性フォトマスク保護膜に応用
2	 $\text{HOCH}_2(\text{CF}_2)_6\text{CH}_2\text{OH}$ (アルコール)	1H,1H,8H,8H-Pefluoro octane-1,8-diol	90177-96-1	海洋生物の付着防止用フッ素化ポリウレタン塗料原料
3	 $\text{HOC}_6\text{F}_4\text{OH}$ (ベンゼン誘導体)	Tetrafluorobenzene-1,4-diol	771-63-1	高い透明性と低い複屈折率とを持つ完全フッ素化ポリイミドの原料
4	 $\text{C}_6\text{F}_5\text{CH}=\text{CH}_2$ (ベンゼン誘導体)	2,3,4,5,6-Pentafluoro styrene	653-34-9	ブロック共重合体は PTFE より良好な撥水性、撥溶剤性を示す
5	 $(\text{C}_2\text{F}_5\text{CO})_2\text{O}$ (カルボン酸および誘導体)	Pentafluoropropionic anhydride	356-42-3	ラインエッジラフネスが小さいネガ型フォトレジスト原料
6	 $\text{FSO}_2\text{CF}_2\text{COOCH}_3$ (硫黄化合物)	Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate	680-15-9	機器汚染性の少ない EUV フォトレジストの光酸発生スルホン酸モノマー原料

7	 <p>C₆F₅-SO₂Cl (硫黄化合物)</p>	Pentafluorobenzene sulfonyl chloride	832-53-1	非イオン性光酸発生性モノマー原料. 光カチオン硬化塗料触媒.
8	 <p>HC₆F₄OH (ベンゼン誘導体)</p>	2,3,5,6-Tetrafluorophenol	769-39-1	ホトレジストの感度、解像度を改善するためモノマー型光酸発生剤をレジストに導入し解像度を上げる試みが行われている。
9	 <p>4-HO-C₆F₄-COOH (ベンゼン誘導体)</p>	4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid (abb;HF4BA)	652-34-6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 光導波路用の芳香族 AB2 型モノマーを調整. 2. ポリフルオロフェノール類の微生物脱フッ素水酸化反応を検討.
10	 <p>C₈F₄O₃ (ベンゼン誘導体)</p>	Tetrafluorophthalic anhydride	652-12-0	部分フッ素化 PIs により、高温下でも高周波 ; 10GHz での誘電率、誘電損失がさらに改善されることを見出した。

*分類は弊社ウェブサイト、「製品情報/インスピレーション バックナンバー」の分類に対応しております。

<https://www.fluorine1.com/product.html>

以上